Searching PAJ Page 1 of 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-253643

(43) Date of publication of application: 30.09.1997

(51)Int.Cl.

CO2F 1/42 BO1J 47/02

B01J 47/06

(21)Application number: 08-066270

(71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

22.03.1996

(72)Inventor: OSAWA KIMINOBU

## (54) DEIONIZED WATER MAKING METHOD

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of live bacteria within a mixed bed type ion exchanger by passing hot water through the mixed bed type ion exchanger having a cation exchange resin and an anion exchange resin built therein and subsequently passing raw water through the mixed bed type ion exchanger to produce deionized water.

SOLUTION: In producing deionized water by passing raw water through a mixed bed type ion exchanger 3, hot water is passed through the mixed bed type ion exchanger 3 packed with a cation exchange resin and an anion exchange resin to subject the ion exchanger 3 to sterilization treatment. In this hot water sterilization treatment, at a time of the rising of an apparatus, for example, a sub-system is sterilized by hot water of 80-90°C (not water of 80-90°C) of a LE membrane apparatus 7 is constitution.

example, a sub-system is sterilized by hot water of 80-90°C. At this time, the permeated water (hot water of 80-90°C) of a UF membrane apparatus 7 is circulated to the inlet of the mixed bed type ion exchanger 3 without being discharged out of the system to sterilize the mixed bed type ion exchanger 3. By this constitution, the mixed bed type ion exchanger 3 can be sterilized along with the sterilization of the sub-system.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

03.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3468259

[Date of registration]

05.09.2003

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許山麻公開科号

## 特開平9-253643

(43)公開日 平成9年(1997)9月30日

(51) Int.CL		識別配号	庁内整理番号	ΡI			技術表示智所
C02F	1/42			C 0 2 F	1/42	В	
B01J	47/02			B01J	47/02	В	
	47/08				47/08		

#### 審査部球 未部球 結束項の数1 OL (全 5 页

•		水阻耳等	未說來 對來與の数 I OL (全 5 與)		
(21)出顧番号	特顧平3-66270	(71)出旗人	000001063 栗田工業株式会社		
(22)出頭目	平成8年(1996)3月22日		京京都新宿区西新宿3丁目4番7号		
		(72) 発明者	大輝 公仲		
特許法第30条第1項適用申請有り 平成7年12月11日発 行の化学工業日報に掲載			東京都新宿区西新宿3丁目4番7号 栗田 工業株式会社内		
		(74)代键人	弁建士 萬野 剛		

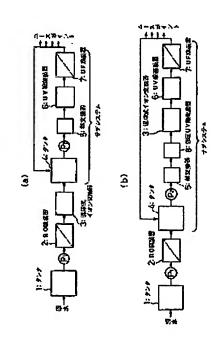
### (54) [発明の名称] 脱イオン水製造方法

## (57)【要約】

【課題】 復床式イオン交換器を用いて脱イオン水を製造するに当り、 健床式イオン交換器での生菌の発生を防止する。

【解決手段】 陽イオン交換制脂及び除イオン交換制脂 を内蔵した浸床式イオン交換器3に熱水を通水した後、 原水を通水して脱イオン水を製造する。

【効果】 装置運転開始に当り、陽イオン交換樹脂及び 降イオン交換樹脂を内蔵した復床式イオン交換器を熱水 で殺菌処理することにより、復床式イオン交換器からは 破遇に到るまで生菌が発生しないようになる。提床式イ オン交換樹脂本来の除菌、殺菌性能により、流入する生 菌をも殺菌し、健床式イオン交換器以降の系内を無菌状 療に維持するととができるようになる。



(2)

#### 【特許請求の箇囲】

【語求項1】 陽イオン交換制脂及び除イオン交換制脂 を内蔵した混床式イオン交換器に通水して脱イオン水を 製造する方法において、

1

該陽イオン交換樹脂及び陰イオン交換樹脂を内蔵した復 床式イオン交換器に熱水を通した後、原水を該混床式イ オン交換器に通水して脱イオン水を製造することを特徴 とする脱イオン水製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は脱イオン水製造方法 に係り、特に、提床式イオン交換器を用いて脱イオン水 を製造するに当り、復床式イオン交換器の除菌、殺菌性 能を有効に発揮させて、良好な処理水を得る方法に関す

#### [0002]

【従来の技術】混床式イオン交換器を利用した脱イオン 水の製造システムの従来例を図1に示す。

【①①①3】図1(a)は、医薬分野で用いられる精製 水製造システムの系統図であり、原水(前処理水)は、 タンク1及びポンプP、を経て逆浸透(RO)膜装置2 及び混床式イオン交換器3で処理された後、タンク4、 ポンプP、、熱交換器 5、 紫外線 (UV) 殺菌装置 6及 び限外流過(UF)膜装置でよりなるサブシステムで処 理され、ユースポイントに送給される。

【①①04】図1(b)は、半導体分野で用いられる超 純水製造システムの系統図であり、原水となる純水(脱 塩水)は、タンク1及びボンプP、を経てRO膜装置2 で処理された後、タンク4、ポンプP2、熱交換器5、 低圧UV酸化鉄圏8、泥床式イオン交換器3、UV殺菌 35 制脂を内蔵した混床式イオン交換器に熱水を運した後、 装置6及びUF 膜装置 7よりなるサブンステムで処理さ れ、ユースポイントに送給される。

【0005】なお、これらのシステムにおいては、装置 の道転開始に当り、サブシステムを熱水又は葉品により 殺菌する。例えば、図l(a)に示す精製水製造システ ムにおいて熱水殺菌を行う場合には、タンク4内の水を 熱交換器5で80~90℃に加熱した後、UV製菌装置 6及びUF膜装置7に通水する。このUF膜装置7の濃 縮水及び透過水は系外へ排出する。また、ユースポイン トからタンク4に到る配管は蒸気による減菌処理が行わ 40 ができるようになる。 れる.

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の精製水製造 システムでは、混床式イオン交換器の処理水に生菌が存 在するため、サブシステムが短時間で生菌により汚染さ れる。この生菌は、UV殺菌装置で完全に除去すること はできず、時間の経過と共に、系内に生菌が増殖するこ ととなる。

【りり07】即ち、泥床式イオン交換器の泥床式イオン

いても復床式イオン交換器による殺菌効果が期待される が、実際には、混床式イオン交換器の流出水中には生菌 が存在し、この生菌数は、経時的に増加する傾向にあ

【0008】との復床式イオン交換器の生菌は、樹脂の 充填に当り、予め復床式イオン交換器のタンク(ベッセ ル)及び樹脂自体の殺菌を行っても発生し、通常の場 台、混床式イオン交換器流出水中には10'~10'個 /100cc程度の生菌が存在する。 そして、この生菌 10 数は運転時間の経過と共に増大する。この復床式イオン 交換器における生菌の増殖の原因の詳細は明らかではな いが、タンク (ベッセル) に勧縮を充填する際に生じる 外部汚染によるものと推測される。

【① 0 0 9 】 とのような混床式イオン交換器における生 菌汚染は、図1(り)に示す超絶水製造システムの混床 式イオン交換器においても問題となっており、とれらの システムにおいて、泥床式イオン交換器における生菌の 発生を防止する方法の開発が望まれている。

【0010】本発明は上記従来の問題点を解決し、復床 20 式イオン交換器を用いて脱イオン水を製造するに当り、 混床式イオン交換器での生苗の発生を防止すると共に、 泥床式イオン交換樹脂本来の除菌、殺菌性能を有効に発 **掴させて、良好な処理水を得る方法を提供することを目** 的とする。

### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の脱イオン水製造 方法は、陽イオン交換制脂及び陰イオン交換制脂を内蔵 した混床式イオン交換器に通水して脱イオン水を製造す る方法において、該陽イオン交換樹脂及び陰イオン交換 原水を該復床式イオン交換器に通水して脱イオン水を製 造することを特徴とする。

【0012】とのように装置運転関始に当り、陽イオン 交換樹脂及び陰イオン交換樹脂を内蔵した混床式イオン 交換器を熱水で製蔵処理することにより、泥床式イオン 交換器は破過(イオンブレーク)に到るまで生菌を発生 させることがない。そして、泥床式イオン交換樹脂本来 の除菌、殺菌性能により、流入する生菌も殺菌され、泥 床式イオン交換器以降の系内を無菌状態に維持すること

#### [0013]

【発明の真施の形態】以下に本発明の実施の形態を説明 する.

【①014】本発明においては、泥床式イオン交換器 に、原水を通水して脱イオン水を製造するに当り、泥床 式イオン交換器に陽イオン交換樹脂及び陰イオン交換樹 脂を充填した後、熱水を通し、陽イオン交換樹脂及び陰 イオン交換制脂を内蔵した健床式イオン交換器を製菌処 選する。

交換樹脂には殺菌能力があり、精製水製造システムにお 50 【①015】本発明において、この殺菌処理に用いる熱

水は、絶水を加熱したものであることが好ましく。用いる熱水の温度は、殺菌効果の面から、60℃以上、好ましくは70℃以上、より好ましくは85℃以上であることが増ました。

3

【0016】また、熱水の流通速度はSV=2~100 hr<sup>-1</sup>程度とするのが好ましく、熱水による穀菌処理時間は15分以上、特に30分以上とするのが好ましい。 【0017】なお、本発明では、このように復床式イオン交換器に熱水を通水するために、系内の熱水と接触する部分、例えば、復床式イオン交換器のタンクや配管は、ステンレス等の耐熱性材料で構成する必要がある。 【0018】本発明の脱イオン水製造方法は、図1

(a), (b) に示すような医薬向け舗製水製造システム。 半導体向け超絶水製造システム。その他、混床式イオン交換器を用いて脱イオン水を製造する各種のシステムに適用することができる。

【0019】例えば、本発明を図1(a)に示す医薬向け結製水製造システムに適用する場合、次のようにして復床式イオン交換器の熱水製菌を行うことができる。即ち、前述の如く、このシステムでは、装置の立ち上げに20 限し、80~90℃の熱水でサブシステム内の製菌を行う。そして、この殺菌処理において、UF 膜装置7の濃縮水及び透過水は系外へ排出する。本発明の適用に当っては、このサブシステムの殺菌処理において、UF 膜装置7の透過水(80~90℃の熱水)を系外に排出することなく、復床式イオン交換器3を熱水で殺菌する。このようにすることにより、サブシステムの殺菌と共に復床式イオン交換器の殺菌も行うことができる。この混床式イオン交換器の殺菌も行うことができる。この混床式イオン交換器の殺菌も行うことができる。この混床式イオン交換器の殺菌も行うことができる。この混床式イオン交換器3の流出水は系外へ排出しても良く、また、後段のタ 30 ンク4に送給しても良い。

【① ① 2 ① 】上記方法は本発明の衰縮の一例であって、 復床式イオン交換器には、別途用意した純水を加熱して 得られた熱水を通水するようにしても良い。

【0021】なお、本発明においては、タンクに陽イオン交換制脂及び陰イオン交換制脂を充填した後に当該混床式イオン交換器に熱水を追水するものであるが、混床式イオン交換器のタンク、並びに、このタンクに充填する陽イオン交換樹脂及び陰イオン交換樹脂もそれぞれ充填に先立ち殺菌処理して用いるのが好ましい。具体的には、タンクは、121℃以上の蒸気を10~30分間程度追して殺菌する。また、陽イオン交換樹脂及び陰イオン交換樹脂は、各々、60℃以上の熱水に15~60分間程度浸渍処理して殺菌する。

[0022]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて、本発明を より具体的に説明する。

【0023】実施例1,比較例1

図2に示す試験装置を用いて、原水(厚木市水)の処理 を行った(処理水量0.5m² /hr)。

【0024】図2の試験装置は、原水を活性炭増11で 処理した後、タンク12を経てポンプ13でRO職装屋 14に送って、RO膜分解処理し、競返過水を熱交換器 15を経て復床式イオン交換器16A、16Bに2等分 して過水し、各々処理水を得るものである。

【0025】活性炭塔11の活性炭としては(株)クラレ製「クラレコールKV」を用い、RO膜装置14のRO験としてはデサリ社製「SG4040C2H」(41nch)を4本用いた。また、浸床式イオン交換器16A、16Bとしては、葉田工業(株)製「KVI EXーMG」(25L)を用い、SV=10hr<sup>-1</sup>に設定した。

[0026] 健床式イオン交換器16A、16Bのイオン交換樹脂としては、各々、80℃の熱水に1時間浸漬した後、陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:1で混合したものを用いた。

[0027]まず、復床式イオン交換器16A、16Bのタンクに上記イオン交換樹脂を充填する前に、配管17より130°Cの蒸気を3kgf/cm²で2時間注入し、混床式イオン交換器16A、16Bのタンクを殺菌処理し、その後、イオン交換樹脂を充填した。

[0028]次に、運転を開始したが、この運転開始後 1時間の間は、RO順装置14の透過水を熱交換器15 で80℃に加熱し、この加熱水を源床式イオン交換器1 6Aのみに通水した。

【0029】その後、RO機装置14の透過水を熱交換器15で25℃に調整し、混床式イオン交換器16A、16Bに等通水量で20日間連続通水した。このような処理に当り、RO膜装置の返過水(RO処理水)の生菌数と、混床式イオン交換器16A(実施例1)及び浸床式イオン交換器16B(比較例1)の各処理水の生菌数及び比抵抗値の経時変化を調べ、結果を表1に示した。

[0030]表1より、混床式イオン交換器に樹脂を充 導した後、熱水を通水することにより、樹脂の破過に到 るまで生菌の流出を防止できることがわかる。

[0031]

【表1】

		(4)					特闘平9-253643
	5				_		6
運転開始 からの 経過日数			赛 抱	) (	比较	PJ L	
		P. O 処理水 生菌数	統床式イオ のA 9 1	混床式イオン交換器 16日の処理水			
	在河口数	(個/100年)	生 歯 数 (個/100cc)	比抵抗促 (NΩ·cm)	生 菌 数 (個/100cc)	比抵抗值 (祝Ω·cm)	
	1日目	6.3×10³	UN	18.0<	159	18.0<	
	8日日	3. 1×10 <sup>4</sup>	(B)	18.0<	2,1×10°	18.0<	
	10日目	3.5×10³	ND OF	18.0<	5.5×10°	18.0<	
	) 5日日	4. (×10 <sup>3</sup>	ND	18.0<	5, 2×10"	18.0<	
	20日目	2.5×10°	70	2.5	2.5×10*	3. l	

ND:検出せず

## [0032]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の脱イオン水 製造方法によれば、復床式イオン交換器を用いた関イオ 20 る超純水製造システムの系統図である。 ン水の製造に当り、泥床式イオン交換器における生菌の 発生を防止すると共に、混床式イオン交換器による殺菌 作用で、泥床式イオン交換器から無菌水を取り出すこと が可能となる。

【0033】このため、提床式イオン交換器の後段のU V数菌装置を省略したり、或いは、サブシステムの殺菌 処理の頻度を低減したりすることが可能となり、高水質 の脱イオン水を低コストで効率的に製造することができ るようになる。

【図面の簡単な説明】

\*【図1】図1 (a) は医薬分野で用いられる精製水製造 システムの系統図、図l(b)は半導体分野で用いられ

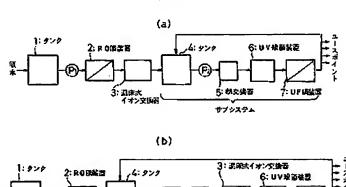
【図2】実施例1及び比較例1で用いた試験装置の系統 図である。

**介 UF協装管** 

【符号の説明】

- 1. 4 タンク
- 2 RO膜装置
- 3 混床式イオン交換器
- 5 熱交換器
- 6 UV殺菌装置
- 7 UF膜装置
- \*30 8 低圧UV酸化装置

[図1]



5: 双文操作 8: NEUVEREZE

サブシステム

(5) 特関平9-253643

